



Настольная установка безмасковой литографии ML100

НАСТОЛЬНАЯ УСТАНОВКА БЕЗМАСКОВОЙ ЛИТОГРАФИИ ML100

Настольная установка безмаскового совмещения и экспонирования предназначена для формирования рисунка в слое фоторезиста на пластинах и подложках.

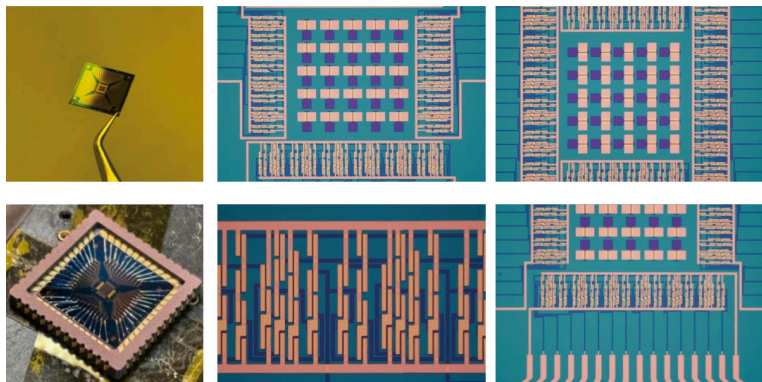
Установка использует технологию DMD (Digital Micromirror Device), позволяя уйти от необходимости использования фотошаблонов, что существенно сокращает производственный цикл, а также затраты на производство или исследования.

Использование светодиодного источника в установке ML100 позволяет получать идеально гладкие стенки формируемых структур.



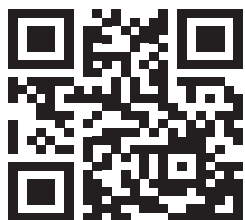
ТИПОВЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- МЭМС
- Микрофлюидика
- Датчики, сенсоры
- Фотодетекторы
- Функциональные покрытия



ОСОБЕННОСТИ

- Компактный дизайн для настольного применения
- Высокая точность совмещения
- Высокая однородность экспонирования – более 90%
- Автоматическая фокусировка в режиме реального времени
- Высокая гибкость
- Долгий срок службы светодиодного источника
- Идеальное решение для лабораторных и научно-исследовательских работ

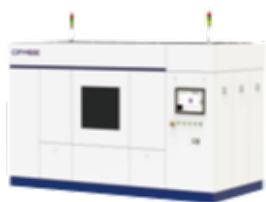


+7 (499) 398-0770
www.akmicrotech.ru
sales@akmicrotech.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСТОЛЬНОЙ УСТАНОВКИ БЕЗМАСКОВОЙ ЛИТОГРАФИИ ML100

Конфигурация системы	Базовая	Профессиональная
Размеры подложек	4"	4", 8"
Толщина подложек	0 - 10 мм	0 - 10 мм
Разрешение	0,8 мкм	0,5 мкм
Точность совмещения	±0,5 мкм	±0,5 мкм
Точность сшивания	±0,3 мкм	±0,3 мкм
Источник излучения	LED, 405 нм	LED, 405 нм
Область экспонирования	0,16 * 0,16 мм (при 0,5 мкм); 0,4 * 0,4 мм (при 0,7 мкм); 0,8 * 0,8 мм (при 1 мкм); 1,6 * 1,6 мм (при 2 мкм)	
Скорость экспонирования	20 мм²/мин (мин.размер элемента 1 мкм)	80 мм²/мин (мин.размер элемента 1 мкм)
Рабочий стол	Ручной поворотный стол, механизм выравнивания, точность позиционирования ±0,25 мкм	Электрический поворотный стол, механизм выравнивания, точность позиционирования ±0,25 мкм
Поддерживаемые форматы	DXF, GDS, bmp, png и другие	

СЕРИИ И МОДИФИКАЦИИ



Установка безмасковой литографии с точностью совмещения ±150 нм



Компактная высокоскоростная установка безмасковой литографии



Установка безмасковой литографии для пластин диаметром до 300 мм